⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

許 公 報(B2) ⑫ 特

昭63-16325

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 昭和63年(1988)4月8日

C 01 B 21/087 // C 01 B 21/068

7508-4G Z - 7508 - 4G

発明の数 2 (全8頁)

②発明の名称

無機ポリシラザン及びその合成方法

前層塞査に係属中

犯特 顧 昭58-247240 舒公 開 昭60-145903

❷出 顧 昭58(1983)12月29日

@昭60(1985)8月1日

切発 明 者 磯田 武 志

埼玉県新座市東北1丁目11番地の5

⑫発 明 者 新井 幹郎

埼玉県入間郡大井町大字亀久保1902番地の5

⑪出 願 人

東亜燃料工業株式会社

東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号

配代 理 人

弁理士 産田

審査官

和 子

匈参考文献

米国特許4397828(US, A)

1

の特許請求の範囲

1 一般式SiH₂X₂(式中Xはハロゲン原子)で示 されるジハロシランと塩基とを反応させてジハロ シランのアダクツを形成させたのち、該ジハロシ により合成される無機ポリシラザンであつて、該 無機ポリシラザンは、一般式、

で表される繰り返し単位を有する直鎖状構造を包 含し、690~2000の分子量を持ち、1分子中に3 ~10個のSiH。基を有し、化学分析による元素比 各重量%であり、並びに溶媒可溶でかつ溶媒の除 去直後に固化することを特徴とする無機ポリシラ ザン。

 一般式SiH_eX_e(式中Xはハロゲン原子)で示 シラザンを合成する方法において、上記ジハロシ ランと塩基とを反応させてジハロシランのアダク ツを形成させ、次いで該ジハロシランのアダクツ とアンモニアとを反応させて上記無機ポリシラザ ンを形成させることを特徴とする無機ポリシラザ 25 時間が長く、加熱工程が煩雑である上、得られる ンの合成方法。

2

発明の詳細な説明

≪産業上の利用分野≫

本発明はポリシラザン及びその合成方法に関す る。更に詳しくは、本発明は窒化珪素を製造する ランのアダクツとアンモニアとを反応させること 5 ための前駆体として使用することのできる無機ポ リシラザン及びその合成方法に関する。

≪従来技術≫

窒化珪素焼結体は、高温強度、耐熱衝撃性、耐 酸化性に優れているため、ガスタービン、ディー 10 ゼルエンジン等の高温構造材料として、或いは切 削用パイト等、省エネルギー、省資源に多大の寄 与をし得る高性能材料の一つとして重要である。

従来、窒化珪素の製造方法としては、①金属シ リコン枌末を窒素又はアンモニア気流中で、1300 率がSi:59~61、N:31~34及びH:6.5~7.5の 15 ℃~1500℃で加熱して直接窒化するシリコン直接 窒化珪素焼結法、②シリカ又は含シリカ物質を炭 素と共に窒素雰囲気下で加熱し、尿素でシリカを **退元して、生成するケイ素と窒素とを反応させる** シリカ還元法、⑧四塩化珪素とアンモニアとを高 されるジハロシランとアンモニアとから無機ポリ 20 温で直接反応せしめる気相合成法、④四塩化珪素 をアンモノリシスして得られるシリコンジイミド を非酸化性雰囲気中で加熱して窒化珪素を得るイ ミド熱分解法等が採用されている。

> しかしながら、上記①の方法の場合には、反応 窒化珪素は粗大で不純物を多く含む β 型窒化珪素 が主体であり、②の方法の場合には、原料の精製

が困難なばかりでなく、反応時間が長く、得られ る生成物はα型窒化珪素とβ型窒化珪素の混合系 であり、③の方法の場合には、生成した窒化珪素 は一般に非晶質であり、④の方法の場合には、高 純度のα型窒化珪素を収率よく製造し得るという 5 利点が有るものの、窒化珪素前駆体であるシリコ ンジイミド (Si(NH)。) x は溶媒に溶けないた めに実質的に用途が限定されざるを得ない等の欠 点があつた。

更に、最近、有機ポリシラザンを熱分解して得 10 られるポリシラザンを800℃~2000℃で加熱して 窒化珪素を焼成する方法も提案されている(斎藤 擊、截維学会誌第38巻第1号第65頁~第72頁 (1982年))が、この方法では窒化珪素と同時に炭 化珪素や遊離の炭素が生成するという欠点があつ 15 り、用途が極めて制限されたものである。

一方、溶媒に可溶である無機ポリシラザンは、 1921年にA、Stock等によって合成されており(A、 Stock and K.Somieski、Ber.dt.Chem.Ges、第 54巻第740頁(1921年))、1982年にはSeyferth等 20 によって (D.Seyferth and G.H.Wiseman, C. Prud'Homme、J.Am.Ceram.Soc.、第66卷、第 C-13頁(1983年))、これが窒化珪素前駆体とし て有用であることが証明されている。本発明者等 処理することにより、高純度のα型窒化珪素を得 る方法を提供した(特開昭59-207812号公報)。

しかしながら、従来の無機ポリシラザンの製造 方法においては、何れの場合も気化性の高いジク ロロシランを原料として用いるために、①反応装 30 置のガス配管又は反応器壁に生成したポリシラザ ンが固着してガス流路を閉塞する恐れがあるこ と、②上記弊害を防止するためジクロロシランの 飛散を抑制する必要があり、反応温度を低温に維 持する必要があること③ジクロロシランは毒性及 35 て有用な無機ポリシラザンを容易に収率よく合成 び引火性が強いので低温密閉容器に入れて利用せ ねばならない等取扱が煩雑であること等の欠点が あつた。更に、合成されたポリシラザンは人 Stock等の場合には、一(SiH₂NH) n 一の構造 を有するn=7~8のオリゴマーにすぎず(A. 40 ≪問題を解決するための手段≫ Stock and K.Somieski、Ber.dt.Chem.Ges、第 54巻、第740頁(1921年))、常温では粘性のある 液体であり、D.Seyferth等の場合にはA.Stock等 の場合より複雑な構造を有し、Si-H/N-Hの

プロトン比が約3.3の油状液体であるが、約200℃ で加熱するか室温で3日~5日放置することによ る固化するものであり(D.Seyferth、G.H. Wiseman, C. Prud'Home, J. Am. Ceram. Soc., 第66巻、第C-13頁(1983年))、いずれのポリシ ラザンの場合であつても、常温で速やかに賦形化 する、窒化珪素焼結体のための前駆体として十分 な性質を有していると言えるものではなかつた。 ≪発明が解決しようとする問題点≫

しかしながら、上記の如き従来の製造方法によ り得られる無機ポリシラザンは、反応溶媒に可溶 であるが溶媒除去後も粘性油状体であり、速やか に固化し得るものではない。従つて、このような 無機ポリシラザンは常温での賦形化が困難であ

又、従来提案されている無機ポリシラザンの合 成方法においては、高い分子量のものを収率良く 合成することは困難であり、より良い合成方法の 開発が望まれていた。

従つて、本発明は、反応溶媒に可溶であるが、 溶媒除去後は、連やかに固化し常温で賦形化可能 な新規無機ポリシラザンを提供することを目的と する。

更に、本発明は、高純度の窒化珪素の前駆体と は、かかる観点に注目し無機ポリシラザンを加熱 25 して有用な無機ポリシラザンを提供することを他 の目的とする。

> 又、本発明は、賦形化窒化珪素に転化可能な無 機ポリシラザンを提供することを他の目的とす

その他、本発明は、反応溶媒可溶で、溶媒除去 後速やかに固化し、賦形化可能な、新規無機ポリ シラザンを容易に収率よく合成する方法を提供す ることを目的とする。

更に、本発明は、高純度窒化珪素の前駆体とし する方法を提供することを他の目的とする。

又、本発明は、賦形化窒化珪素に転化可能な無 機ポリシラザンを容易に収率よく合成する方法を 提供することを他の目的とする。

本発明の上配の諸目的は、一般式、

含し、690~2000の分子量を持ち、化学分析によ る元素比率がSi:59~61、N:31~34及びH: 6.5~7.5の各重量%であり、溶媒可溶でかつ溶媒 の除去直後に固化することを特徴とする無機ポリ シラザンの創出によって達成された。

そして上記の如き、化学構造上の特異性を有す る無機ポリシラザンは、一般式SiH2

X₂(式中Xはハロゲン原子) で示されるジハロ シランと塩基とを反応させてジハロシランのアダ ツとアンモニアとを反応させることにより合成さ れる。

一般にハロシランは酸性であり、塩基と反応し てアダクツを形成することができる。このアダク ロシランの酸性の強さと塩基性物質の塩基性の強 さや立体因子等に依存するので、本発明において は、アダクツとして安定である一方、アンモニア と反応して無機ポリシラザンを容易に製造するこ に、ハロシランの種類と塩基の種類を適宜選択す る。この場合のアダクツの安定性は、必ずしも、 アダクツとして単離できる程度の安定性を意味す るものではなく、溶媒中で安定に存在する場合の べての場合を包含する。

本発明において使用するハロシランとしては、 その取扱い性や反応性の観点から、一般式 SiH₂X₂(X=F、Cl、Br、 l) で表されるジハ 原料価格等の観点から、特にジクロロシランを使 用することが好ましい。

本発明で使用することのできる塩基は、ハロシ ランとアダクツを形成する反応以外の反応をしな い塩基であり、このような塩基としては例えば、40 ルイス塩基、3級アミン類(トリアルキルアミ ン)、ピリジン、ピコリン及びこれらの誘導体、 立体障害性の基を有する2級アミン類、フオスフ イン、スチピン、アルシン及びこれらの誘導体等

6

(例えばトリメチルフオスフイン、ジメチルエチ ルフオスフイン、メチルジエチルフオスフイン、 トリエチルフオスフイン、トリメチルアルシン、 トリメチルスチピン、トリメチルアミン、トリエ で表される繰り返し単位を有する直鎖状構造を包 5 チルアミン、チエフエン、フラン、ジオキサン、 セレノフエン、等)を挙げることができるが、中 でも、低沸点でアンモニアより塩基性の小さい塩 基(例えばピリジン、ピコリン、トリメチルフオ スフイン、ジメチルエチルフオスフイン、メチル 10 ジェチルフオスフイン、トリエチルフオスフイ ン、チオフエン、フラン、ジオキサン、セレノフ エン、等) が好ましく、特にピリジン及びピコリ ンが取扱上及び経済上から好ましい。使用する塩 基の量は、特に厳密である必要はなく、アダクツ クツを形成させたのち、該ジハロシランのアダク 15 中のアミンを含めて、シランに対して化学量論的 量、即ちアミン:シラン=2:1より過剰に存在 すれば足りる。

本発明のアダクツを経由する無機ポリシラザン の合成方法の実施態様としては、第1に上記のハ ツの形成速度及びアダクツとしての安定性は、ハ 20 ロシランと塩基を反応せしめて生成したアダクツ を反応溶媒に加える方法、第2にハロシランを塩 基を含有する反応溶媒に加える方法、第3にハロ シランを塩基溶媒に加える方法を挙げることがで きるが、この場合反応溶媒の選択は、非反応性の とのできるアダクツを容易に生成せしめるよう 25 溶媒の中からポリシラザンの溶解度のみに着目し て行うことができ、ハロシランの溶解度を考慮せ ずに広い範囲から選択することができる。

本発明で使用する溶媒としては、軽質溶媒(例 えばヘキサン、ベンゼン、ピリジン、塩化メタ みならず、実質的に反応中間体として機能するす 30 ン、エーテル、アセトニトリル等)が好ましい が、特に好ましいものとして例えばピリジン及び 塩化メタンを挙げることができる。

アダクツを経由する本発明のポリシラザンの合 成方法においても、本質的にはハロシランとアン ロシランを選択することが好ましく、反応性及び 35 モニアとを非反応性溶液中で反応させ重合せしめ るものであるから、アンモニアは本発明の合成方 法において必須である。しかしながら、その使用 量は厳密なものではなく、シランに対して過剰に あれば良い。

> 本発明のポリシラザンの合成における反応条件 は、反応温度が−78℃~100℃、好ましくは−40 ℃~80℃であれば、反応速度が大きいために反応 時間にも反応圧力にも特に制限されることがな い。反応温度が一78℃以下の場合には、反応溶媒

に可溶なポリシラザンの収率が低下し、又反応温 度が100℃以上の場合には、生成したポリシラザ ンが再び分解するので好ましくない。

上記無機ポリシラザンの重合反応は不活性ガス 雰囲気下に行うのが好ましく、不活性ガスとして 5 は窒素又はアルゴンが好適である。

本発明の上記の如き反応操作によって脱ハロゲ ン化水素縮合反応が起こり、生成したポリシラザ ンは溶媒中に溶解している。副生したアンモニウ 液と容易に分離することができる。次に、該ポリ シラザン溶液から溶媒を除去すると無色透明な液 状から無色固体状に至る無機ポリシラザンが得ら れる。又該液状無機ポリシラザンは室温状態で放

このようにして得られた無機ポリシラザンの赤 外吸収(IR)スペクトル(ヌジョール法)は、 第1図に示す如く、波数 (cm⁻¹) 3380、1175の づく吸収;並びに915のSi-N-Siに基づく吸収 を示している。

又、「H一核磁気共鳴(NMR)スペクトル (CDCI:溶媒) は、第2図に示す如く、SiH領域 と略称) とδが4.3ppmのSiH₂(SiH₈と略称) に 基づく二つの吸収があり、NH領域ではδが 1.33ppmのNHに基づく吸収が表れることを示し ている。

ンは、後述の実施例においても示す如くSiH。基 が著しく多いという特異的な構造を有するもので あることがわかる。

本発明のポリシラザンの化学分析による元素比 各重量%である。

上記赤外吸収スペクトル、H一核磁気共鳴スペ クトル及び化学分析の結果は、本発明のポリシラ ザンが

主として

8

で表される繰り返し単位を有する直鎖状構造を包 含するものであることを示す。

本発明にかかるポリシラザンの蒸気圧降下法に よつて測定した分子量は690~2000の範囲である。 本発明においては、上記の如き合成法にて得る ことのできるポリシラザン化合物を窒素の存在下 で加熱処理し、高純度で且つ α型結晶構造比の高 い、つまり、α型結晶構造比が70%以上の窒化珪 素を製造することもできる。本発明で言う窒素の ム塩は例えば濾別することによりポリシラザン溶 10 存在下とは、アンモニア単独、窒素単独あるいは 窒素と不活性ガスとの混合ガス例えば窒素と水 素、窒素とアンモニア、窒素とアルゴンあるいは 含窒素分解ガス、例えばアンモニア分解ガス等を 意味し、窒素元素を含むことを必須とするもので 置することにより半透明固体状の無機ポリシラザ 15 ある。混合ガスを用いる場合、その割合を特に制 限するものではないが、窒素元素を過剰に含むも のであることが望ましい。

窒化珪素焼結体の原料粉末としての窒化珪素 は、一般に高純度で且つα型結晶構造を持つこと NHに基づく吸収; 2160、1000、860のSiH_xに基 20 が好ましい。これは、α相を原料に用いると焼結 処理中にα相→β相への転移が起こり、その結果 として焼結性の向上及び繊維状組織の発達が現 れ、高強度の窒化珪素焼結体が得られるからであ る。本発明によつて合成したポリシラザンを用い では、δが4,72ppmのSiH₂及び/又はSiH(SiH。25 て、70%以上がα型であつて焼結性が極めて優れ た窒化珪素を高収率で得るためには、加熱処理温 度を特に1000℃~1100℃といった限られた範囲内 にしなければならない。

加熱処理温度が例えば500℃以下といつた極端 このスペクトルからみて、本発明のポリシラザ 30 に低い温度の場合には、未反応の塩素や水素の除 去が不完全で、得られた窒化珪素中に塩素や水素 を含むこととなり、又処理温度が1900℃を超える と生成した窒化珪素が解離することとなり、いず れも好ましくない。又、処理温度が上記の如き温 率はSi:59~61、N:31~34及びH:6.5~7.5の 35 度でないとしても、本発明で得たポリシラザンを 700℃から1000℃未満で処理すれば、主として非 晶質の窒化珪素及び珪素の混合物が得られ、又 1100℃を越え1900℃以下の温度で処理すれば主と してβ型の窒化珪素が得られることとなり好まし 40 くない。

> 加熱処理の時間は、加熱によつて副生する水素 の生成が停止する時間が一応の目安となるが、高 温では比較的短く、低温では比較的長く、又、結 晶を熟成するためには比較的長くするが、特に制

限するものでない。好ましい加熱処理時間は、8 時間~20時間、特に好ましくは10時間~16時間で ある。

又、加熱炉内で窒素雰囲気下でポリシラザンを 加熱処理する時、非酸化物材料例えば窒化珪素、 5 炭化珪素、タンタル、モリブデン等で作られた炉 材を用いることが望ましい。

以上の条件によって初めて窒素含有率39%以 上、塩素含有率0.001%以下の高純度の、かつ70 ことができる。又、必要ならば窒化珪素の焼結促 進に有効であると知られている元素、例えば Mg、Y、Fe、B等を含有した窒化珪素を得るこ ともできる。

≪発明の効果≫

本発明においては、固体状で安定に反応溶媒中 に存在し得るジロハラシランのアダクツとアンモ ニアを実質的な原料として無機ポリシラザンを合 成するために、従来のジハロシランを直接の原料 とする場合に生ずるハロシランの飛散や反応装置 20 の閉塞等の不都合を防止することができるのみな らず、(1)ハロシランの飛散がないので反応温度を 従来以上に上げることができ、(2)反応物中にハロ シランの濃度を実質的に高めることができる等の ることができる。又、アダクツを経由せしめるこ とにより、無機ポリシラザンの重合反応が容易と なり、収率及び分子量を大幅に向上せしめること ができる上、未反応のアダクツは濾過等により、 とができるので、本発明の無機ポリシラザンの合 成方法は作業性が良く、従来の方法より極めて優 れた方法である。

更に、本発明においては、粘性油状の無機ポリ 望に応じて容易に合成することができ、この無機 ポリシラザンは反応溶媒を除去することにより、 速やかに固化するので賦形化することができる。 このように賦形化した場合には、それを加熱処理 することにより全く新規な賦形化窒化珪素を得る 40 と高収率であつた。 ことができるので、かかる観点からも本発明は極 めて有意義である。そして、上記の性質を利用す れば本願発明によるポリシラザンは、繊維はいう までもなく、従来のポリシラザンでは達成されな

10

かつた種々の用途、例えば、セラミツクスの観密 化剤、セラミツクス粉体又は繊維の結合剤又はセ ラミツクス構造体の表面被覆剤に用いることがで きる。

以下、実施例により本発明を更に詳述するが、 本発明はこれにより限定されるものではない。 ≪実施例≫

実施例 1

内容積300×1の四つ口フラスコにガス吹き込み %以上がα型結晶構造体とされる窒化珪素を得る 10 管、メカニカルスターラー、ジュワーコンデンサ ーを装着した。反応器内部を脱酸素した乾燥窒素 で置換した後、四つ口フラスコに脱気した乾燥ビ リジン150叫を入れ、これを氷冷した。次に、ジ クロロシラン16.1 8 を50分間かけて加えたとこ 15 ろ、白色固体状のアダクツ (SiH₂Cl₂・2Py) が 生成した。反応混合物を氷冷し、激しく攪拌しな がら、ソーダライム管及び活性炭管を通して精製 したアンモニア10.9 € を窒素ガスと混合して、1 時間かけて吹き込んだ。

反応終了後、固体生成物を遠心分離した後、更 に濾過して除去した。瀘液から溶媒を域圧除去 (50℃、5 mHg、2時間) すると、ガラス状固体 ポリシラザン5.52∮が得られた。得られたポリシ ラザンの赤外吸収スペクトル及び「H一核磁気共 理由から無機ポリシラザン合成の反応速度を高め 25 鳴スペクトルは第1図及び第2図に示した通りの ものであった。核磁気共鳴分析では、生成物溶液 中の反応溶媒(ピリジン)を、測定溶媒 (CDCLs) で置換して使用した。生成物はこの測 定溶媒に可溶であつた。この¹H―核磁気共鳴ス 容易に、生成した無機ポリシラザンと分離するこ 30 ベクトルによればSiH領域においてδが4,72ppm のSiH、δが4.3ppmのSiHに基づく吸収があり、 NH領域ではδが1.33ppmのNHに基づく吸収が 表れた。これらの吸収スペクトルから第1表に示 す如く、SiHa/SiHa=3.7、(SiHa+SiHa)/ シラザンからガラス伏の無機ポリシラザン迄、所 35 NH=4.8であることが読み取られ、この結果 l 分子中のSiHs基の数が7.1と算出された。

> 又、化学分析による元素組成(重量%)は、 Si:61.0、N:31.0、H:7.0であり、蒸気圧降下 法による分子量は2000であつた。又、収率は77%

本実施例で得られたポリシラザンをジクロロメ タンに溶解したポリシラザンの濃厚溶液を、ノズ ルから窒素雰囲気中25℃に保つた容器に吐出させ た後、滅圧下25℃で3時間保持して溶媒を除去

し、繊維状ポリシラザンを得た。次いで、得られ た繊維状ポリシラザン0.3%を、アルミナの管状 炉内、窒素気流中で、1時間で120℃から1100℃ まで昇温しそのまま 4時間保持した。室温迄放冷 した後得られた生成物は、繊維状の薄褐色固体で 5 あつた。この固体は、化学分析の結果、珪素含有 率39.5%、塩素含有率0.001%以下であり、α相 含有率80%の窒化珪素であることが、粉末X線回 析によつて確認された。

ンが常温で容易に賦形化し、これによつて、賦形 化窒化珪素焼結体が得られることを実証するもの である。

実施例 2

いて、これに脱気した乾燥ピリジン52以及びジク ロロメタン40叫を入れた。四つ口フラスコに脱気 した乾燥ジクロロメタン110叫を入れ、これを氷 冷した後、ジクロロシラン (SiH,Cl2) 16.1 9 を ジクロロシランに20分間かけて滴下した。白濁し た反応混合物を激しく撹拌しながら、精製したア ンモニア10.98 を窒素ガスと混合して 1 時間かけ て吹き込んだ。反応中、ガス流路に粉霧は全く発 生しなかつた。

反応混合物を実施例1と全く同様に処理する と、極めて粘性の高い油状ポリシラザン4928が 得られた。本実施例の場合にも収率は68%であ り、従来法の場合より極めて良いことが確認され た。得られた油状のポリシラザンを放置しておく 30 と、室温下10分以内でガラス状固体となり、室温 で賦形化するのに好都合であることが確認され た。

また、上記油伏ポリシラザンを実施例1と同様 に示す如く、SiHa/SiHa=2.9、(SiHa+ SiHa) /NH=45の結果を得た。この分析結果 から1分子中のSiH,基の数は3.9と算出された。 比較例 1

コに脱気乾燥したジクロロメタン150mを入れ、 これを氷冷した後ジクロロシラン16.1 8 を加え 12

た、この溶液を氷冷しながら、精製したアンモニ ア10.99を窒素との混合ガスとして 1 時間かけて 吹き込んだ。反応中、ガス流路に粉霧が発生した のでガス流路を時々たたいて閉塞を防いだ。

反応混合物を実施例1と全く同様に処理する と、粘性油状ポリシラザン3.3%が得られた。収 率は46%であり、本発明の方法の場合より極めて 低いものであつた。粘性油状ポリシラザンに CDCIa溶媒を加えたところ、ポリシラザンは全量 この結果は、本発明で合成した無機ポリシラザ 10 溶媒に溶解したので、実施例1と同様に、これを *H-核磁気共鳴分析に供し、そのスペクトルか ら第1表に示す如く、SiHA/SiHa=7.8、(SiHA +SiH₈) /NH=3.1の結果を得た。このデータ から算出される1分子中のSiH₃基の数は、0.97で 実施例1で使用した装置の他に滴下ロートを用 15 ありこのことから、1分子中にSiHa基は多くと も1個しか存在しないということがわかつた。 又、得られたポリシラザンの蒸気圧降下法によつ て測定した分子量は552と小さく粘性も低いため、 室温で固化するのに2日~5日も要し、本発明の 加えた。氷冷を続けながら上記のピリジン溶液を 20 場合とは異なり室温で賦形化するのは困難であつ

> 以上、実施例1、2及び比較例のポリシラザン に対する「H一核磁気共鳴スペクトルの分析結果 をまとめると、次の第1表に示すようになる

第 1 表 'H-核磁気共鳴(比)

		SiH./ SiH.	(SiHA+ SiHB)/NH	 1分子中の Sill。基の数	分子 量
	実施例1	3, 7	4,8	7.1	2000
)	実施例2	2.9	4,5	3, 9	870
	比較例1	7.8	3, 1	0.97	552

第1表から明らかなように、本願ポリシラザン は、従来のものに比し、分子量が大きいばかりで なく、1分子中のSiHs基の数も多く、これらの に'H一核磁気共鳴分析に供したところ、第1表 35 特異な構造上の相違が賦形性に富むという従来に ない優れた物性をうみ出したものと思われる。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明で得られた無機ポリシラザン のヌジョール法による赤外吸収スペクトルであ 実施例1と同一の装置を用いた。四つ口フラス 40 る。第2図は、本発明で得られた無機ポリシラザ ンのNMRスペクトルである。

25



